2013 年 2 月 22 日

報道関係者　各位

会社名　　レーザーテック株式会社
東証第二部コード６９２０
横浜市港北区新横浜２－１０－１

代表者名　代表取締役社長　岡林　理
発表担当　企画 IR 室 室長 浅井　浩志

新製品 EUV マスク裏面検査/クリーニング装置「BASIC シリーズ」を発表

【概　要】

レーザーテック株式会社は、EUV マスク裏面の検査、測定、及びクリーニングが可能な「**BASIC シリーズ**」を製品化致しました（**BASIC** は、**Ba**ck**s**ide **I**nspection and **C**leaning system for EUV mask の略称です)。

【背　景】

レーザーテック株式会社は、1976 年に世界で初めて、半導体用マスク欠陥検査装置を開発・販売し、マスク検査分野で長い歴史と経験を持つ会社です。現在販売中のマスク欠陥検査装置 MATRICS、マスクブランクス欠陥検査装置 MAGICS シリーズは、その優れた欠陥検出性能や低ランニングコストにより高い評価をいただき、今日世界中のウェハファブ、マスクショップ、及びマスクブランクスメーカで活躍しております。

今日、半導体分野では、さらなる微細化に向けた次世代技術として、EUV リソグラフィの研究・開発が加速しています。EUV スキャナーによるパターン露光では従来と異なり、マスクの保持のために静電チャックが必要となります。その際、EUV マスク裏面に異物が付着した状態でスキャナーの静電チャックに吸着すると、マスク基板が歪んで露光パターン位置にずれが生じます。EUV 露光の安定稼働にはマスク裏面のクリーン化や静電チャックの異物管理等が求められております。

「**BASIC シリーズ**」は、このようなニーズにお応えする新製品です。特長は（１）EUV マスク裏面異物検出に最適化された光学系による異物検査機能（２）EUV 露光に影響を及ぼす異物を特定するためのコンフォーカル光学系による異物高さ測定機能、及び（３）異物をクリーニング（除去）する異物除去機能を有することです。さらに、マスクの搬送システムでは、発塵リスクが無くパターンにダメージを与えないデュアルポッドハンドリング方式を採用しました。

本装置を EUV マスクハンドリング技術開発から EUV マスク裏面の定期的な管理に利用することによって、EUV マスク裏面の安定的なクリーン度の確保が可能となります。ウェハファブ、マスクショップ、ブランクスメーカでの EUV マスク裏面の品質管理にご活用ください。

【特　長】

- EUV マスク裏面の異物検出に最適化した検査光学系
- EUV 露光に影響を及ぼす異物の高さ測定機能
- EUV 露光に影響を及ぼす異物のクリーニング（除去）機能
- 発塵リスクの無いデュアルポッドハンドリング方式
- パターンにダメージを与えないスキャン方式
- EUV 量産において適用可能な検査時間
- OHT(Overhead Hoist Transport)と連動した全自動検査
- 電源・制御系統を本体に内蔵したオールインワン設計によるコンパクト化

【用　途】

- ウェハファブにおける EUV マスク裏面の定期管理・受け入れ検査
- EUV マスク裏面の異物の検出・高さ測定・クリーニング
- マスクメーカ、ブランクスメーカにおける出荷検査

【主な仕様】

装置サイズ（mm）	1550(幅) x 2955（奥行） x 2400（高さ）
対応基板サイズ	EUV マスク(6 インチ)

BASIC シリーズは、検査、測定、及びクリーニングを基本機能としますが、ご要望に応じて各機能を組み合わせたモデルもご用意しております。お気軽にお問い合わせください。



BASIC シリーズ

◇お問い合わせ先◇
〒222-8552　横浜市港北区新横浜 2-10-1
レーザーテック株式会社　　第一営業部 マネージャー　坪内 隆雅
TEL：045-478-7337　　**FAX**：045-478-7333　**E-mail**： sales@Lasertec.co.jp